

474919-2026 - Gara

Paesi Bassi – Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) – European Tender Electron Beam Lithography system
OJ S 130/2026 09/07/2026
Bando di gara o di concessione – regime ordinario - Avviso di rettifica
Forniture

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: Universiteit Twente

E-mail: c.delfgaauw@utwente.nl

Forma giuridica del committente: Impresa pubblica

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Istruzione

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: European Tender Electron Beam Lithography system

Descrizione: The University of Twente is tendering to purchase an Electron Beam Lithography system. The MESA+ Institute of the University of Twente will invest in a new Electron Beam system (e-beam system). A system, suitable for defining patterns in electron sensitive resists, at high resolution and high speed, compatible with a wide range of applications and substrate types up to 200mm in diameter. The system will be used by a wide range of users, i.e. academic researchers and students as well as industrial engineers with different backgrounds (photonics, (nano)-electronics etc.) and different levels of expertise.

Identificativo della procedura: d75e7f85-f950-4008-ab95-b4ee18bf06fa

Identificativo interno: 379fcf7e-45c5-4d48-b8ea-3be831450e85

Tipo di procedura: Aperta

La procedura è accelerata: no

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 38000000 Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

Classificazione aggiuntiva (cpv): 38341100 Registratori di fasci elettronici

2.1.2. Luogo di esecuzione

Paese: Paesi Bassi

Ovunque nel paese in questione

Informazioni supplementari: Zie documentatie

2.1.3. Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 3 500 000,00 EUR

2.1.4. Informazioni generali

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

2.1.6. Motivi di esclusione

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0000

Titolo: European Tender Electron Beam Lithography system

Descrizione: The University of Twente is tendering to purchase an Electron Beam Lithography system. The MESA+ Institute of the University of Twente will invest in a new Electron Beam system (e-beam system). A system, suitable for defining patterns in electron sensitive resists, at high resolution and high speed, compatible with a wide range of applications and substrate types up to 200mm in diameter. The system will be used by a wide range of users, i.e. academic researchers and students as well as industrial engineers with different backgrounds (photonics, (nano)-electronics etc.) and different levels of expertise.

Identificativo interno: 0b4a476d-7047-4e2b-907c-d85c9f9859e4

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 38000000 Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

Classificazione aggiuntiva (cpv): 38341100 Registratori di fasci elettronici

5.1.2. Luogo di esecuzione

Paese: Paesi Bassi

Ovunque nel paese in questione

Informazioni supplementari: Zie documentatie

5.1.3. Durata stimata

Durata: altro: Sconosciuto

5.1.5. Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 3 500 000,00 EUR

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto finanziato in tutto o in parte con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara, Documento di gara unico europeo (DGUE)

5.1.11. Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://s2c.mercell.com/today/217278>

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Consentita

Indirizzo per la presentazione: <https://s2c.mercell.com/today/217278>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: inglese

Catalogo elettronico: Non consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: 21/08/2026 10:00:00 (UTC+00:00) ora dell'Europa occidentale, GMT

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 90 Giorni

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Fatturazione elettronica: Consentita

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì

5.1.15. Tecniche**Accordo quadro:**

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Rechtbank Overijssel

Informazioni sui termini per il riesame: See descriptive document.

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso:

Universiteit Twente

8. Organizzazioni**8.1. ORG-0001**

Nome ufficiale: Universiteit Twente

Numero di registrazione: 50130536

Indirizzo postale: Drienerlolaan 5

Località: Enschede

Codice postale: 7522NB

Suddivisione del paese (NUTS): Twente (NL213)

Paese: Paesi Bassi

Referente: Camilio Delfgaauw

E-mail: c.delfgaauw@utwente.nl

Telefono: +31534891512

Indirizzo internet: <https://www.utwente.nl>

Profilo del committente: <https://s2c.mercell.com/buyer/16033>

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso

8.1. ORG-0002

Nome ufficiale: Rechtbank Overijssel

Numero di registrazione: 82940525

Località: Almelo

Codice postale: 7607 GB

Suddivisione del paese (NUTS): Twente (NL213)

Paese: Paesi Bassi

E-mail: communicatie.rb-ove@rechtspraak.nl

Telefono: (+31)0883611042

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

10. Modifica

Versione dell'avviso precedente da modificare

:

d8072cd8-e497-49af-b432-8865f10c18de-01

Motivo principale della modifica

:

Rettifica errore committente

Descrizione

:

Recently, the University of Twente has started a tender-procedure for the purchase of an electron beam lithography system (T217278 European Tender Electron Beam Lithography system). Unfortunately, we have realized that the Descriptive Document contained several (minor) short-comings. More specific, in the revised Descriptive Document a time-slot for site-inspection is included, as well as a correct textual description of the weighting of the three award criteria is inserted at the end of section 4.2 (viz. 70% (wishes; G1), 10% (sustainability; G2) and 20% (price; G3)). In appendix B Schedule of Requirements and Wishes – the subsection regarding ‘(extended) warranty’ has been removed (table P) and added to the maintenance subsection (see item O.2 in table O).

10.1. Modifica

Identificativo della sezione: LOT-0000

I documenti di gara sono stati modificati il: 08/07/2026

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: d3fc913d-812e-4d95-a132-8a6de8b80aa4 - 01

Tipo di formulario: Gara

Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Sottotipo di avviso: 16

Data di trasmissione dell'avviso: 08/07/2026 06:24:13 (UTC+00:00) ora dell'Europa occidentale, GMT

Data di trasmissione da parte dell'eSender dell'avviso o bando: 08/07/2026 06:24:25 (UTC+00:00) ora dell'Europa occidentale, GMT

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: inglese

Numero di pubblicazione dell'avviso: 474919-2026

Numero dell'edizione della GU S: 130/2026

Data di pubblicazione: 09/07/2026